

# Cestello Quadrato In Ptfе Per Pulizia Wafer Portapannelli In Fluoropolimero Per Incisione Semiconduttori Portapiastrelle Di Silicio Personalizzato

Numero articolo: PL-CP89



## introduzione

Ottimizza i processi di banco umido per semiconduttori con i nostri cestelli quadrati personalizzati in PTFE per la pulizia dei wafer. Progettati per un'estrema resistenza chimica e una manipolazione ad alta purezza, questi portapezzi in fluoropolimero offrono durabilità e precisione superiori per le operazioni critiche di incisione e pulizia dei wafer di silicio.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Incisione wafer di silicio	Immersione del substrato in agenti di incisione acidi per rimuovere strati superficiali o creare texture specifiche.	Eccezionale resistenza alle miscele di HF e acido nitrico.
Pulizia celle solari	Pulizia in più fasi di wafer fotovoltaici quadrati di grande formato prima della drogatura o del rivestimento.	Capacità di manipolazione ad alto volume con rotture minime.
Lavorazione MEMS	Manipolazione di sistemi microelettromeccanici durante le fasi critiche di rilascio chimico.	Un ambiente ad alta purezza previene la contaminazione microscopica.
Pulizia ad ultrasuoni	Utilizzo all'interno di bagni ad ultrasuoni per rimuovere particelle submicroniche da ottiche o componenti elettronici di precisione.	Proprietà di smorzamento proteggono le parti delicate dai danni da vibrazione.
Analisi dei metalli in traccia	Preparazione e pulizia di vetreria da laboratorio in bagni di acido ad alta purezza per chimica analitica.	Interferenza di fondo più bassa possibile per la rilevazione a livello di PPB.
Manipolazione substrati LED	Supporto per wafer di zaffiro o carburo di silicio attraverso cicli aggressivi di pulizia e risciacquo.	Affidabilità a lungo termine in processi chimici ad alta temperatura.
Stoccaggio e trasporto chimico	Contenimento sicuro di substrati sensibili durante il transito tra moduli di cleanroom.	Superfici non reattive proteggono la chimica superficiale del wafer.
Ricerca di laboratorio	Portapezzi di dimensioni personalizzate per la lavorazione di materiali sperimentali in università e laboratori di R&S.	Progetto adattabile per adattarsi a configurazioni sperimentali non standard.

Categoria di specifica	Dettagli parametri per PL-CP89
Identificazione modello	PL-CP89
Dimensioni standard	249mm x 249mm (Configurazione quadrata)
Composizione materiale	PTFE (Politetrafluoroetilene) 100% ad alta purezza
Compatibilità chimica	Universale (eccetto metalli alcalini fusi e fluoro elementare)
Intervallo di temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Metodo di fabbricazione	Lavorazione CNC completa da billetta solida

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Categoria di specifica	Dettagli parametri per PL-CP89	
Capacità wafer	Completamente personalizzabile (numero di fessure e passo variabili)	
Larghezza fessura	Lavorata di precisione (personalizzabile in base allo spessore del wafer)	
Caratteristiche di drenaggio	Porte di flusso laterali e sulla base integrate per lo scambio di fluidi	
Opzioni maniglia	Disponibili opzioni di maniglie in PTFE staccabili o integrate	
Finitura superficiale	Finitura lavorata liscia e non porosa per prevenire l'intrappolamento di particelle	
Conformità	Conforme RoHS, materie prime di grado FDA	